



## Stopper für AR-Resists

### AR 600-60, 600-61 Stopper

Zum Abstoppen von E-Beamresistschichten nach der Entwicklung mit Lösemitteln

#### Charakterisierung

- sofortiges Unterbrechen der Entwicklung
- hochreine Lösemittelgemische zur rückstands-freien Entfernung der Entwicklerreste
- AR 600-60 für AR-P 617, 630-670 er, 6200
- AR 600-61 für AR-P 6510

#### Eigenschaften I

Parameter / AR	600-60	600-61
Dichte bei 20 °C (g/cm <sup>3</sup> )	0,785	0,964
Wassergehalt max. (%)	0,1	20
Nichtflüchtiges max. (%)	0,002	0,002
Flammpunkt (°C)	12	105
Filtrationsgrad (µm)	0,2	
Lagerung bis 6 Monate (°C)	10-22	

#### Hinweise zur Stopperverarbeitung

Mit dem Abstoppen nach der Entwicklung für etwa 30 s wird der Entwicklungsprozess unterbrochen und ein rasches Abspülen der Entwicklerreste erreicht.

Durch den Verarbeitungsprozess wird ständig Entwickler in das Stopperbad verschleppt. Schon relativ geringe Mengen des Entwicklers beeinträchtigen die Effizienz des Stoppens. Es wird deshalb ein ständiger Wechsel des Stoppers oder die Verwendung von zwei nacheinander angeordneten Stopperbädern empfohlen.

Durch einen 10-20 %igen Zusatz des Stoppers AR 600-60 in die Entwickler AR 600-50, 600-55 und 600-56 kann eine Verlangsamung des Entwicklungsprozesses erreicht werden.

Setzt man beim AR-P 630 - 670 als Entwickler den Stopper AR 600-60 ein, sind höhere Kontrastwerte bis 10 möglich. Damit einher geht eine verringerte Empfindlichkeit des PMMA-Resists. Es werden höhere Bestrahlungsdosen und längere Entwicklungszeiten benötigt.

Hinweis: Setzt man beim AR-P 630-670 als Entwickler den Stopper AR 600-60 ein, sind höhere Kontrastwerte bis zu 10 möglich.